

国際電気標準会議（IEC / TC47テルフト会議）報告

TC47 / WG4会議概要

TC47 / WG4会議は10月28日オランダのデルフトにて開催された。

3件の国際標準化の提案

10月28日にオランダのデルフトにて開催されたIEC（国際電気標準会議）/ TC47（第47技術委員会）に出席。現在わが国から国際標準化提案を行っているマイクロマシン / MEMS専門用語と、平成11年から13年にかけて実施した基準創成研究開発事業の成果を国際標準化提案した「薄膜材料の引張試験法」ならびにその「標準試験片」に関する審議に参加すると共に、今年度よりスタートしたエネルギー使用合理化システム標準化調査研究により実施する「薄膜材料の疲労試験」についてその計画を報告して国際的な協力の要請を行った。現在、わが国からナノ材料分野で提案しているのはこの3件のみとのこと。

各提案の審議状況

既に本財団より平成14年7月に提案し、現在CD（Committee Draft）の段階にある「マイクロマシン / MEMS専門用語」については、韓国、中国から出されているコメントについて審議を行い本専門用語はCDV（Committee Draft for Vote）とする。但しFDIS（Final Draft for Vote）に際してはメンテナンスの時期を明確にする事が求められた。

薄膜材料の引張試験に関する2件の標準化提案は今年7月に国際提案を行ったもので10月10日にNP（New Proposal）になったばかりであるが、英文表現について英、米からのコメントがあったものの、問題の本質に係わることは無いことからこれの受け入れを表明することで、基本的課題が無くなったことから次の段階のCD

に進むことが承認され、日本が2004年3月にドラフトを提出することが決まった。何れも1段階前進する事が出来た。

新たなWG会議の開催

韓国から、2004年6月にジュネーブかフェニックスでWG会議を開催し、MEMSのGeneric specification（通則）作成を協議しようとの提案があった。通則の中で用語集、引張試験法、疲労試験法等、今後作成するMEMS規格を位置付けていきたいとの考えである。日本もこの意見に賛成し、WG開催が決定された。

出席者

WG出席者は以下のとおり。

- R. Turnur
（UK、主査、KBCI）
- Kuniki Owada
（Japan、国際標準化工学研究所）
- Akira Umeda
（Japan、産総研）
- M. Konno
（Japan、マイクロマシンセンター）
- Sekwang Park
（Koror, Kyungpook National University）
- Sang-Geun Lee
（Korea、Agency for Technology and Standards）
- Bo Cui
（China、Hebei Semiconductor Research Institute）
- Miao Lu
（China、Hebei Semiconductor Research Institute）